

Intelligent On-line Monitoring Technical -Trace Contaminants in Semiconductor process 半導體製程線上微污染監測應用技術研討會

半導體製程技術從10年前跨入28 nm製程後，不斷的創新與突破。時至今日已跨入10 nm以下製程線寬要求，所對應到生產環境品質的控管與製程材料的規格面臨更嚴峻的要求與挑戰。在先進製程中線寬縮小的趨勢下，製程中只要有微污染之有機或無機物的殘留，就會產生無法預期之製程風險進而影響產品的良率。

此微量污染物可能來自於環境中的AMC (VOCs, Acid & Base Ion in Air) 和材料中的Metal Impurity 或 Nano-particle等，而這些環境與製程材料微污染以傳統建置的QC實驗室監控模式，人為及非自動化可能會造成的取樣污染、量測手法的差異、數據彙整和判讀耗時等等，早已無法滿足先進製程的需求。

近十年來，金兆益科技致力於半導體產業微污染監測技術之開發與精進，針對製程環境與材料所需開發出不同應用的「線上即時微污染監測設備」，對於環境變異可有效地提出警示且賦予它智能性，若出現環境處於異常的判斷時設備能進行自動檢核、除錯。就專業而言，若能確實做到針對各微污染物進行全定量的在線即時監測，即可掌握污染物的來源，進而有效且快速移除可能的威脅，是提高製程的良率不可或缺的好伙伴。

會議時間/地點

時間:
2018年6月22日(星期五)
上午8:30 - 下午 16:00

地點: [Map](#)
新竹豐邑喜來登大飯店 東館 五樓 禮堂
新竹縣竹北市光明六路東一段265號

時間	內容	講師
08:30 ~ 09:15	Registration	
09:15 ~ 09:25	Welcome Remarks	邱純玉 協理
09:25 ~ 10:00	Semiconductor Monitoring Equipment with AI Application	侯建中 經理
10:05 ~ 10:45	Advanced VOCs Monitoring Technical in Fab	張原豪 經理
10:45 ~ 11:00	----- Break (15 min) -----	
11:00 ~ 11:45	MA / MB Contaminants Monitoring NFA-C350 Introduction	林姍姍 副理
11:45 ~ 12:00	On-line AMC Discussion	
12:00 ~ 13:30	----- Lunch -----	
13:35 ~ 14:35	Trace Metal Impurity Analysis Application for Semiconductor Process	張瑞玫 技術協理 許卿恆 BASF副理
14:35 ~ 14:50	----- Break (15 min) -----	
14:50 ~ 15:40	Advanced Nano-particle Analysis Technology for Semiconductor Application	張瑞玫 技術協理
15:40 ~ 16:00	Nano-particle - Discussion	

報名方式:

請於網路系統詳填報名資訊

<https://o.new-fast.com.tw/seminar2018/?p=1>

或用 e-Mail 回覆報名至 info@new-fast.com.tw

本活動全程免費，備有精緻午餐及茶點，免費停車，

席次有限，敬請立即報名！

洽詢專線：(03) 5502509 #109 Amy 張小姐

*主辦單位得保留本研討會日期及課程之變更權利，如有任何更動將另行通知。



立即報名

